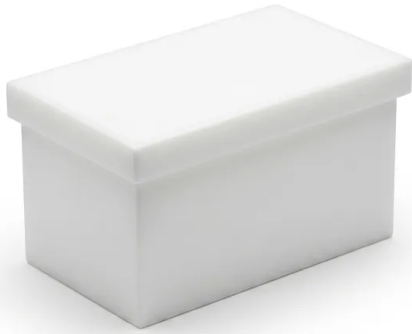


高纯度聚四氟乙烯 (Ptfе) 带盖方槽，耐腐蚀低背景特氟龙水槽，适用于痕量分析

货号: PL-CP220



简介

这款高纯度带盖 PTFE

方槽专为痕量分析和严苛的化学处理而设计，具有卓越的耐腐蚀性和极低的背景水平。可根据您的实验室或工业要求进行定制加工，以实现最大的耐用性和化学惰性。

。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
痕量金属分析	用作 ICP-MS 或 AAS 分析样品的消解罐或储存罐。	最大限度地减少可浸出的污染物，确保 ppt 级的准确度。
半导体晶圆清洗	用作使用侵蚀性氟化酸蚀刻或清洗硅片的浴槽。	防止设备腐蚀，同时保持超高纯度水平。
药物合成	适用于涉及腐蚀性催化剂或高纯度医药中间体的批量反应。	确保没有增塑剂或添加剂浸入活性成分中。
电池研究	用于电极材料在侵蚀性电解质中的浸泡和测试。	抵抗锂盐和有机碳酸盐的腐蚀性。
酸浸与消解	为地质或冶金样品的各种热酸浸取提供安全环境。	支持高温酸处理而不会发生结构失效。
贵金属回收	用于利用王水溶解和精炼金、铂和钯。	对最强烈的氧化性酸混合物具有完全的耐受性。
高纯试剂储存	作为超纯实验室化学品的二次容器或主要储存容器。	长期的化学稳定性，不会降低所储存试剂的纯度。

特性	规格详情 (型号: PL-CP220)
材料	100% 高纯度原生 PTFE (聚四氟乙烯)
货号	PL-CP220
容量选项	3L, 5L, 或完全定制容量
耐温性	-200°C 至 +260°C
耐化学性	通用 (熔融碱金属和元素氟除外)
表面处理	光滑、无孔的 CNC 加工表面
设计类型	带可拆卸盖子的方形/长方形
壁厚	根据结构要求定制
尺寸公差	精确的 CNC 公差 (可根据图纸定制)
盖子样式	松配合或精密阶梯密封盖
背景水平	极低 (适用于痕量元素分析)